© 2015 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії

PACS numbers: 75.20.En, 75.30.Et, 75.47.Np, 75.70.Cn, 75.75.Cd, 76.50.+g, 81.40.Rs

ФМР в обмінно-зв'язаних багатошарових структурах

I. М. Козак, Д. М. Поліщук, А. Ф. Кравець, В. О. Голуб, V. Korenivski^{*}

Iнститут магнетизму НАН та МОН України, бульв. Акад. Вернадського, 36⁶, 03142 Київ, Україна ^{*}Nanostructure Physics, Royal Institute of Technology, 10691 Stockholm, Sweden

В даній статті наведено результати досліджень феромагнетного резонансу (ФМР) в обмінно-зв'язаних багатошарових структурах типу «феромагнетик (Ni₈₀Fe₂₀)/слабомагнетний прошарок (Ni_xCu_{100-x})/закріплений феромагнетик (Co₉₀Fe₁₀/Mn₈₀Ir₂₀)». Визначено магнетні та резонансні параметри досліджуваних структур і встановлено їх залежність від товщини слабомагнетного прошарку, концентрації Ni та температури. Встановлено, що при кімнатній температурі на ФМР-спектрах спостерігаються два сиґнали, які проявляють феромагнетні властивості і відповідають шарам Ni₈₀Fe₂₀ (Py) і Co₉₀Fe₁₀. Показано, що поведінка резонансного поля, ширини лінії та ефективної намагнетованости шару Ру визначається ступенем міжшарової обмінної взаємодії, яка залежить від товщини слабомагнетного прошарку (d) і концентрації (x) атомів Ni в ньому. Найбільшою міжшаровою взаємодією характеризуються зразки з x = 54%, d = 3 нм та з x = 62%, d = 6 нм. Залежність намагнетованости від температури стрімко зростає зі зменшенням температури.

In this article, the results of investigations of ferromagnetic resonance (FMR) in exchange-coupled multilayer structures such as 'ferromagnet ($Ni_{80}Fe_{20}$)/weakly magnetic layer (Ni_xCu_{100-x})/fixed ferromagnet ($Co_{90}Fe_{10}/Mn_{80}Ir_{20}$)' are presented. The magnetic and resonance parameters of these structures are determined, and their dependence on the thickness of weakly magnetic layer, concentration of Ni, and temperature is revealed. In the room-temperature FMR spectra, two signals are observed and display ferromagnetic properties corresponding to the $Ni_{80}Fe_{20}$ (Py) and $Co_{90}Fe_{10}$ layers. As shown, the behaviour of resonance field, line width, and effective magnetization for the Py layer is caused by the interlayer exchange interaction, which depends on both the thickness (*d*) of weakly magnetic layer and the concentration (*x*) of Ni atoms within it. Samples with x = 54%, d = 3 nm and x = 62%, d = 6 nm are characterized by the largest interlayer interaction. The dependence of magnetization

147

tion on temperature rapidly increases with decreasing temperature.

В данной статье приведены результаты исследований ферромагнитного резонанса (ФМР) в обменно-связанных многослойных структурах типа «ферромагнетик (Ni₈₀Fe₂₀)/слабомагнитная прослойка (Ni_xCu_{100-x})/закреплённый ферромагнетик (Co₉₀Fe₁₀/Mn₈₀Ir₂₀)». Определены магнитные и резонансные параметры исследуемых структур и установлена их зависимость от толщины слабомагнитной прослойки, концентрации Ni и температуры. Установлено, что при комнатной температуре на ФМР-спектрах наблюдаются два сигнала, которые проявляют ферромагнитные свойства и соответствуют слоям Ni₈₀Fe₂₀ (Ру) и Co₉₀Fe₁₀. Показано, что поведение резонансного поля, ширины линии и эффективной намагниченности слоя Ру определяется степенью межслоевого обменного взаимодействия, которая зависит от толщины слабомагнитной прослойки (*d*) и концентрации (*x*) атомов Ni в ней. Наибольшим межслоевым взаимодействием характеризуются образцы с x = 54%, d = 3 нм и с x = 62%, d = 6 нм. Зависимость намагниченности от температуры.

Ключові слова: спіновий вентиль, міжшарова обмінна взаємодія, розбавлений феромагнетик, феромагнетний резонанс, намагнетованість.

(Отримано 17 березня 2015 р.)

1. ВСТУП

За останні роки зросла кількість робіт по вивченню властивостей обмінно-зв'язаних багатошарових структур типу спінового вентиля $F_1/f/F_{2pin}$ [1–9], де F_1 — шар феромагнетика, намагнетованість якого можна легко змінювати під дією зовнішнього магнетного поля; F_{2pin} — шар феромагнетика з фіксованим напрямком намагнетованости; f — слабомагнетний прошарок. Ключовим елементом даної структури є слабомагнетний прошарок f [10–14].

В залежності від температури прошарок f може перебувати у парамагнетному стані ($T > T_c^{\text{eff}}$) або у феромагнетному ($T < T_c^{\text{eff}}$); T_c^{eff} — ефективна температура Кюрі слабомагнетного прошарку [14].

У випадку, коли f знаходиться у парамагнетному стані, зміна орієнтації магнетного моменту шару F_1 від антипаралельної до паралельної відносно магнетного моменту закріпленого шару F_{2pin} [15] відбувається у досить низьких магнетних полях. Тобто обмінна взаємодія між феромагнетними шарами F_1 і F_{2pin} відсутня.

Коли *f* перебуває у феромагнетному стані, магнетні моменти цих шарів паралельні, і змінити їхню взаємну орієнтацію можна за допомогою зовнішнього поля. Це є проявом прямої обмінної взаємодії між шарами F_1 і F_{2pin} . Однією з основних умов появи прямої міжшарової обмінної взаємодії у $F_1/f/F_{2pin}$ структурах є те, щоб товщина прошарку *f* була більшою від довжини вільного пробігу спіну електрона [4].

Ефективною та інформативною експериментальною методикою дослідження магнетних властивостей гетерофазних і наноструктурованих систем, включаючи багатошарові магнетні структури, виступає феромагнетний резонанс (ФМР) [16–22].

Основними перевагами ФМР щодо вивчення магнетних багатошарових наноструктур є: (і) висока чутливість, що уможливлює охарактеризувати магнетні властивості тонких плівок та інших нанорозмірних систем (нанострічки, наноточки), що не завжди можливо за допомогою інших методик [17, 23]; (іі) можливість досліджувати властивості окремих складових комплексної (багатофазної чи багатошарової) матеріяльної системи [24, 25].

За допомогою методики ФМР можна охарактеризувати анізотропну поведінку системи, процеси релаксації та перемагнетування, магнетну однорідність матеріялу, збудження спінових хвиль, і визначити такі параметри як ефективна намагнетованість, константи анізотропії, напівширина резонансної лінії, тощо [17, 24, 26–28].

Дослідження ФМР в обмінно-зв'язаних багатошарових структурах [21, 29] є важливою задачею, оскільки за їх допомогою можна не лише якісно описати прояв міжшарової взаємодії, але й кількісно охарактеризувати цей ефект.

У роботі [30] було проведено ФМР-дослідження багатошарових структур типу «спіновий вентиль» з немагнетним прошарком. Наприклад, Лінднер та ін. [31] досліджували методом ФМР тришарові структури, резонансні властивості яких вивчалися в залежності від температури. Авторами було встановлено, що найбільш важлива причина такої залежности слідує із температурної залежности розу порядкування магнетних моментів на межі зі спейсером через термічно активовані спінові хвилі. У роботах [31, 32], число сиґналів, що спостерігались на ФМР спектрах, відповідало кількості феромагнетних шарів.

Однак, робіт, присвячених ФМР-дослідженням багатошарових структур із слабомагнетним прошарком, обмаль [2, 8, 9, 33]. У роботі [33] за допомогою методики ФМР досліджуються тонкі плівки розбавленого феромагнетика Ni_xCu_{100-x} (x = 70-100%). Стоп даного складу виступає основним матеріялом для слабомагнетного прошарку у термомагнетних спінових вентилях нового типу — перемикачах Кюрі [1, 2]. В ході досліджень [33] у тонких плівках було виявлено виникнення обмінно-зв'язаних кластерів Ni, що підвищує магнетну неоднорідність системи, і що має бути враховане при конструюванні багатошарових структур $F_1/f/F_{2pin}$.

Поведінка резонансних параметрів ФМР окремих шарів у багатошарових структурах має відображати характер міжшарової обмінної взаємодії у таких структурах. Дане завдання є актуальним як з практичної, так і фундаментальної точок зору.

2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Магнетні багатошарові структури $Ni_{80}Fe_{20}$ (10 нм)/ $Ni_{x}Cu_{100-x}(d)$ / $m Co_{90}Fe_{10}~(5~{
m Hm})/Mn_{80}Ir_{20}~(12~{
m Hm})/Cu~(5~{
m Hm})$ (далі $F_1/f(x,d)/F_{2pin}$) були одержані методом магнетронного розпорошення мішеней на термічно окислені кремнієві підкладки з використанням мультимагнетронної розпорошувальної системи АЈА Orion. Залишковий тиск у камері становив $\cong 6 \cdot 10^{-9}$ Тор. Осадження проводилося в плазмі аргону при тиску 5 мТорр. Феромагнетні шари Ni₈₀Fe₂₀ (Ру) і Со₉₀Fe₁₀ та антиферомагнетний шар $Mn_{80}Ir_{20}$ були осаджені з окремих мішеней із відповідним номінальним складом. Слабомагнетний шар Ni_xCu_{100-x} осаджували одночасним розпорошенням окремих мішеней чистого Ni та Cu. В одержаних гетероструктурах, антиферомагнетний шар Mn₈₀Ir₂₀ використовувався для створення однонапрямленої магнетної анізотропії у феромагнетному шарі Co₉₀Fe₁₀, що дозволило зафіксувати напрямок намагнетованости в останньому. Від взаємодії з атмосферою структури були захищені шаром Си. Контроль за товщиною шарів у структурі здійснювався за допомогою профілометрії [10]. Склад розбавленого феромагнетного стопу Ni_rCu_{100-r} регулювався шляхом підтримки співвідношення швидкостей осадження Ni i Cu, що контролювалося за допомогою кварцового датчика швидкости осадження плівок.

В даній роботі досліджуються дві серії зразків. Зразки першої серії мають однаковий склад слабомагнетного прошарку $f - \text{Ni}_{54}\text{Cu}_{46}$, що відповідає стопу з точкою Кюрі, близькою до кімнатної температури [34], але відрізняються товщиною шару f (d = 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9 нм). Зразки другої серії мають однакову товщину прошарку $\text{Ni}_x\text{Cu}_{100-x}$ (d = 6 нм), але відрізняться концентрацією Ni в ньому (x = 0, 40, 48, 54, 62 ат.% Ni). Номінальні параметри інших шарів у досліджуваних зразках однакові.

Магнетні властивості гетероструктур $F_1/f(x, d)/F_{2pin}$ досліджувалися за допомогою методу феромагнетного резонансу з використанням ЕПР-спектрометра Bruker ELEXYS-E500, обладнаного автоматичним гоніометром та температурною приставкою. ФМР-міряння виконувалися на робочій частоті $f \approx 9,46$ ГГц (Х-діяпазон) в температурному інтервалі 150–400 К.

Основними параметрами ФМР виступають резонансне поле (H_r) , напівширина лінії (ΔH_{pp}) та інтенсивність (I). На основі одержаних значень резонансного поля H_r , в наближенні, що магнетна поведінка плівки визначається лише анізотропією форми, можна визначити ефективну намагнетованість (M_{eff}) кожного шару з використанням системи Кіттелевих рівнянь [24]:

$$\omega = \gamma \left(H_r^{\perp} - 4\pi M_{\text{eff}} \right), \quad \omega = \gamma \sqrt{H_r^{\parallel} \left(H_r^{\parallel} + 4\pi M_{\text{eff}} \right)}, \quad (1)$$

де H_{\perp} та H_{\parallel} — резонансні поля, одержані за умов, коли зовнішнє поле **Н** перпендикулярне або паралельне до площини плівки відповідно; ω — циклічна частота ($\omega = 2\pi f$); γ — гіромагнетне відношення. В свою чергу, напівширина лінії ΔH_{pp} несе в собі інформацію про магнетну однорідність матеріялу та механізми релаксації [24].

З.РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

На рисунку 1 наведено типові спектри ФМР, одержані для структури $F_1/f(54\%, 6 \text{ нм})/F_{2\text{pin}}$: (a) кутова залежність спектрів ФМР в залежності від орієнтації прикладеного зовнішнього поля **H** відносно нормалі до площини плівки (кут θ), виміряна при кімнатній температурі (кут відхилу $\theta = 0^{\circ}$ відповідає перпендикулярній орієнтації **H** до площини плівки); (б) температурна залежність спектрів ФМР при орієнтації прикладеного поля **H** в площині плівки ($\theta = 90^{\circ}$). Одержані спектри ФМР представляють собою перші похідні від кривої поглинання за рахунок використання модуляційних котушок, що дозволяє підвищити відношення сиґнал/шум [17].

За кімнатної температури на спектрах ФМР для усіх зразків можна чітко виділити два сиґнали (рис. 1, *a*). Обидва сиґнали вияв-



Рис. 1. Типові спектри ФМР, одержані для структури $F_1/f(54\%, 6 \text{ нм})/F_{2\text{pin}}$. (*a*) кутова залежність спектрів ФМР при кімнатній температурі (θ — кут відхилу зовнішнього магнетного поля **H** від нормалі до площини плівки); (*б*) температурна залежність спектрів ФМР за орієнтації прикладеного поля **H** у площині плівки.

ляють феромагнетну поведінку, характерну для тонкої плівки з основним внеском від анізотропії форми: з відхилом напрямку зовнішнього поля Н від площини плівки, резонансне поле зміщується у бік вищих полів і досягає максимуму за перпендикулярної орієнтації Н до площини плівки [17]. Оскільки прошарок Ni_xCu_{100-x} в досліджуваному діяпазоні концентрацій ($x \le 62\%$) характеризується слабомагнетним станом [1, 10, 11], слід очікувати, що сиґнал від нього буде нехтовно малим порівняно з ФМР-сиґналами від сильномагнетних шарів Ру і $Co_{90}Fe_{10}$ [2]. Тому два сиґнали, що спостерігаються, слід віднести саме до цих сильномагнетних шарів. Намагнетованість Co₉₀Fe₁₀ приблизно в два рази більша за намагнетованість Ру. Згідно з Кіттелевими рівняннями (1), за орієнтації поля Н у площині плівки, матеріял з меншою намагнетованістю має більші резонансні поля. Тому першу лінію, що спостерігається при вищих полях ($H_{r1\parallel} \approx 1500$ E), слід віднести до шару Ру, а другу, низькопольову резонансну лінію ($H_{\rm r2\parallel} \approx 100~{\rm E}$) — до шару ${\rm Co}_{90}{\rm Fe}_{10}$. Коли зовнішнє поле Н орієнтоване перпендикулярно до площини плівки $(\theta = 0^{\circ})$, ситуація протилежна: резонансна лінія Ру (лінія 1) спостерігається при нижчих полях, ніж лінія Co₉₀Fe₁₀ (лінія 2). На одержаних спектрах при $\theta = 0^{\circ}$ (рис. 1, *a*) спостерігається лише одна лінія від Ру ($H_{r1^{\perp}} \approx 9 \text{ кE}$), оскільки лінія від Со₉₀Fe₁₀, за рахунок високої намагнетованости матеріялу і дії ефективного поля підмагнетування H_b від АФМ шару $Mn_{80}Ir_{20}$, зміщується у високі поля, які перевищують максимальне поле у наших міряннях ($H_{\text{max}} = 14 \text{ kE}$).

Із пониженням температури поведінка резонансних ліній 1 і 2 відображає збільшення ефективної намагнетованости сильномагнетних шарів F_1 і $F_{2\text{pin}}$ відповідно (рис. 1, б) [17, 24]: за орієнтації прикладеного поля **H** у площині плівки, резонансні поля ліній 1 і 2 зменшуються. Резонансні поля $\text{Со}_{90}\text{Fe}_{10}$ при низьких температурах ($T \leq 250$ K) набувають від'ємних значень. У наближенні, коли поле підмагнетування H_b для шару $F_{2\text{pin}}$ слабо змінюється з температурою у досліджуваному *T*-інтервалі ($H_b(T) \approx \text{const}$), таке зміщення $H_{r2\parallel}$ у від'ємну область полів слід також віднести до збільшення M_{eff} шару. При великих значеннях M_{eff} , робочої частоти набіжного надвисокочастотного випромінення ($f \approx 9,46$ ГГц) недостатньо для збудження ФМР, коли **H** орієнтоване в площині плівки [24].

У досліджуваних структурах $F_1/f(x, d)/F_{2pin}$ зі змінною температури слід очікувати прояв явища обмінної взаємодії між шарами F_1 і F_{2pin} через слабомагнетний прошарок f. Зокрема, цей ефект виникає, коли слабомагнетний прошарок переходить у феромагнетний стан [1, 2, 35]. Тоді такий обмінний зв'язок має найбільше впливати на резонансний сиґнал від вільного шару Ру, оскільки шар $Co_{90}Fe_{10}$ сильно зв'язаний з шаром антиферомагнетика $Mn_{80}Ir_{20}$ і тому менш чутливий до цього ефекту [17]. У зв'язку з цим, далі детально аналізується резонансна поведінка вільного шару Ру. Резонансне поле H_r та ширина лінії ΔH_{pp} були визначені на основі стандартного аналізу спектрів ФМР з використанням другої похідної по полю від лінії поглинання P'' [24]. Згідно цього підходу, $H_r = (H^- + H^+)/2$ і $H_r = (H^- - H^+)/2$, де H^+ і H^- — поля, за яких лінія P''(H) сягає максимуму.

На рисунку 2 наведено кутові залежності резонансного поля для шару Ру (вільний шар F_1), одержані при кімнатній температурі для зразків $F_1/f(54\%, d)/F_{2nin}$ серії 1, які відрізняються за товщиною (d) слабомагнетного шару $Ni_{54}Cu_{46}$ (панель (a)) і для зразків $F_1/f(x, 6)$ нм)/ $F_{2\text{pin}}$ серії 2, які відрізняються концентрацією Ni (x) у прошарку $Ni_{x}Cu_{100-x}$ (панель (б)). Усі кутові залежності $H_{r1}(\theta)$ виявляють поведінку характерну для тонкої плівки, магнетні властивості якої визначаються анізотропією форми [17, 24]. Однак кутові залежності на рис. 2, а дещо відрізняються для зразків з різною товщиною прошарку f: залежності $H_{r1}(\theta)$ для зразків з d = 6 і 9 нм досить близькі між собою, тоді як $H_{r1}(\theta)$ для d = 3 нм виявляє добре помітне зміщення відносно останніх. Оскільки обмінна взаємодія між шарами F₁ i F_{2pin} значно підсилюється зі зменшенням товщини прошарку f [2], то відмінність у залежностях $H_{r1}(\theta)$ для зразків з різною товщиною d слід віднести до різного ступеня впливу міжшарової обмінної взаємодії на вільний шар Ру. З іншої сторони, за сталої температури, величина обмінної взаємодії між шарами F_1 і F_{2pin} залежить від концентрації Ni в слабомагнетному прошарку Ni_xCu_{100-x}. Дійсно, кутові залежності для структур $F_1/f(x, 6 \text{ нм})/F_{2\text{pin}}$ з x = 0, 48і 54% (рис. 2, б) майже збігаються, тоді як для більшої концентрації x = 62% залежність $H_r(\theta)$ зміщується відносно останніх, подібно до $H_{r1}(\theta)$ для $F_1/f(54\%, 3 \text{ нм})/F_{2\text{pin}}$ (рис. 2, *a*). Таким чином, підсилення міжшарової обмінної взаємодії відображається у відмінності кутових залежностей резонансного поля $H_{r1}(\theta)$ для вільного шару



Рис. 2. Кутова залежність резонансного поля $H_{r1\perp}$ для шару Ру: (*a*) для зразків $F_1/f(54\%, d)/F_{2pin}$ — серія 1; (*б*) для зразків $F_1/f(x, 6 \text{ нм})/F_{2pin}$ — серія 2.



Рис. 3. Температурні залежності резонансного поля $H_{r1\parallel}$ шару Ру: (*a*) для зразків $F_1/f(54\%, d)/F_{2pin}$ — серія 1; (б) для зразків $F_1/f(x, 6 \text{ hm})/F_{2pin}$ — серія 2. Пунктирна лінія — температурна залежність $H_{r1\parallel}(T)$ для зразка з x = 0%.

Ру в залежності від товщини прошарку f і об'ємної частки атомів Ni в ньому.

На рисунку 3, а і б наведено температурні залежності резонансного поля $H_{r1\parallel}(T)$ шару Ру, коли зовнішнє поле **H** орієнтоване в площині плівки ($\theta = 90^{\circ}$), для серій зразків 1 і 2 відповідно. На рисунках чітко видно відмінності у залежностях $H_{r1\parallel}(T)$ для зразків з різною товщиною (d) і концентрацією атомів Ni (x) в слабомагнетному прошарку f. Так, для зразків $F_1/f(54\%, d)/F_{2\rm pin}$ зі зменшенням товщини прошарку f спостерігається зміщення залежности $H_{r1\parallel}(T)$ у низькопольову область (рис. 3, а). Подібне зміщення залежностей $H_{r_{1}\parallel}(T)$ також спостерігається для зразків $F_{1}/f(x, 6 \text{ нм})/F_{2\text{pin}}$ з різною концентрацією атомів Ni у прошарку Ni_xCu_{100-x} (рис. 3, б). На обох панелях наведена залежність $H_{r1\parallel}(T)$ для зразка $F_1/f(0\%$, 6 нм)/ F_{2pin} , для якого обмін між шарами F_1 і F_{2pin} повністю відсутній. Ріжниця між значеннями резонансного поля для зразка $F_1/f(0\%, 6 \text{ нм})/F_{2 ext{pin}}$ та полями $H_{r1}(T)$ інших зразків кожної із серій вказує на ступінь міжшарової обмінної взаємодії в цих зразках. Збільшення цієї ріжниці $\Delta H_{r1\parallel}$ з пониженням температури відображає підсилення обміну між F_1 та $F_{2\text{pin}}$ за рахунок поступового переходу прошарку f у феромагнетний стан.

Згідно з Кіттелевим рівнянням (1), менші значення $H_{r\parallel}$ відповідають більшим значенням ефективної намагнетованости M_{eff} [24]. В свою чергу, ефективна намагнетованість, окрім дійсної намагнетованости M, містить внесок від інших видів взаємодій [17], що впливають на магнетну поведінку шару Ру. У нашому випадку M_{eff} також виступає характеристикою обмінної взаємодії між шарами F_1 і F_{2pin} .

На рисунку 4, a, δ наведено температурні залежності ефективної намагнетованости $M_{\rm eff}$ для серій зразків 1 і 2 відповідно. Значення



Рис. 4. Температурна залежність ефективної намагнетованости $M_{\rm eff}$ шару Ру: (*a*) для зразків $F_1/f(54\%, d)/F_{\rm 2pin}$ — серія 1; (б) для зразків $F_1/f(x, 6 \text{ нм})/F_{\rm 2pin}$ — серія 2. Пунктирна лінія — температурна залежність $M_{\rm eff}(T)$ для зразка з x=0%.

 $M_{\rm eff}$ були визначені на основі рівнянь (1) з використанням резонансних полів, наведених на рис. З, а, б. Більші значення ефективної намагнетованости вказують на більший прояв міжшарової обмінної взаємодії. Звідси можна зробити висновок, що найбільшою міжшаровою взаємодією характеризуються зразки $F_1/f(54\%, 3 \text{ нм})/F_{2\text{pin}}$ із серії 1 та $F_1/f(62\%, 6 \text{ нм})/F_{2\text{pin}}$ із серії 2. Окрім цього, для цих зразків залежність $M_{\rm eff}(T)$ найбільш круто зростає зі зменшенням температури, що додатково можна вважати характерною ознакою підсилення міжшарового обміну.

Важливим параметром, що характеризує магнетну однорідність окремих складових у багатошарових структурах, який можна одержати з даних ФМР, є напівширина резонансної лінії [17, 24]. На рисунку 5 показано залежності напівширини (ΔH_{nn}) ФМР-лінії Ру в залежності від товщини (панель а) і концентрації (панель б) при вибраних температурах T = 150, 300, 400 К. Усі зразки характеризуються відносно малою напівшириною лінії ($\Delta H_{pp} \approx 50-70$ E), що вказує на гарну структурну однорідність шару Ру, і виготовлених гетероструктур в цілому [17]. Однак, в залежності від температури, товщини прошарку f і концентрації в ньому атомів Ni, спостерігаються певні відмінності у значеннях ΔH_{pp} . Так, ΔH_{pp} зростає з підвищенням температури для обох серій зразків (див. рис. 5). Збільшення ΔH_{pp} за сталої температури спостерігається для зразків з більшою товщиною d прошарку $Ni_{54}Cu_{46}$ (рис. 5, a). Для зразків $F_1/f(x, 6 \text{ нм})/F_{2 ext{pin}}$ серії 2, ширина ΔH_{pp} зростає з підвищенням концентрації x атомів Ni в прошарку Ni_xCu_{100-x} (рис. 5, δ).

Збільшення напівширини ΔH_{pp} з підвищенням температури для лінії Ру (рис. 5) пов'язане з наближенням до магнетного фазового пе-



Рис. 5. Температурні залежності напівширини резонансної лінії Ру (ΔH_{pp}) в залежності від товщини прошарку f(a) і концентрації атомів Ni в ньому (б) при вибраних температурах T = 150, 300 і 400 К.

реходу (T_{с.еff}^{Ру}≈600 К) [24]. Слід очікувати, що міжшарова обмінна взаємодія підсилює магнетну неоднорідність шару Ру за рахунок особливостей передачі обмінного зв'язку через слабомагнетний прошарок f[2, 8, 9, 11]. Така тенденція чітко спостерігається у поведінці ΔH_{pp} в залежності від концентрації x атомів Ni в прошарку Ni_xCu_{100-x}. Ріжниця між напівшириною лінії Ру для $F_1/f(0\%, 6 \text{ нм})/F_{2 ext{pin}}$, в якому міжшаровий обмін відсутній, та значеннями ΔH_{pp} для зразка $F_1/f(62\%$, $6\,{
m mm})/F_{
m 2pin}$ серії 2, якому характерний найбільший ступінь обмінної взаємодії, складає близько 5 Е для усіх температур (рис. 5, б). Залежність ΔH_{pp} (x% ат. Ni) найбільш стрімко зростає при температурі вимірювань 150 К, що пов'язано з підвищенням міжшарового обміну за рахунок переходу слабомагнетного прошарку f у феромагнетний стан [1, 2]. Однак, описана тенденція щодо зростання ΔH_{vv} з підсиленням міжшарового обміну за рахунок більшої концентрації х атомів Ni у прошарку Ni_xCu_{100-x} , протилежна для залежности $\Delta H_{pp}(d)$ для серії зразків 1 (рис. 5, а). При всіх температурах напівширина лінії Ру має більші значення для зразків з більшою товщиною прошарку f, тобто з найменшим міжшаровим обміном. Таку розбіжність у поведінці ΔH_{pp} для двох серій зразків слід віднести до особливостей механізму обмі́нної взаємодії між шарами F_1 і $F_{2\text{pin}}$, який залежить як від товщини слабомагнетного прошарку f, так і концентрації атомів Ni в останньому [2].

4. ВИСНОВКИ

В ході проведених ФМР-досліджень серії багатошарових структур $F_1/f(x, d)/F_{2pin}$ охарактеризовано залежності резонансних параметрів шарів від температури, товщини прошарку f(d) і концентрації

атомів Ni (x) в ньому. На ФМР-спектрах виявлено два резонансні сиґнали і показано, що вони відповідають феромагнетним шарам F_1 (Py) і $F_{2\text{pin}}$ (Co₉₀Fe₁₀). Виявлено, що кутові і температурні залежності резонансного поля шару Ру для структур з різним x і d відрізняються від таких для структури, що характеризується відсутністю міжшарової обмінної взаємодії (x = 0%). Ця відмінність зростає із зменшенням товщини шару f і збільшенням в ньому концентрації Ni, що вказує на прояв прямої обмінної взаємодії між шарами F_1 і $F_{2\text{pin}}$. Подібна тенденція до підсилення міжшарового обміну спостерігається також у збільшені ефективної намагнетованости шару Ру (M_{eff1}), вирахуваної з ФМР-даних.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- 1. A. F. Kravets et al., *Phys. Rev. B*, 86: 214413 (2012).
- 2. A. F. Kravets et al., *Phys. Rev. B*, **90**: 104427 (2014).
- 3. Ultrathin Magnetic Structures III. Fundamentals of Nanomagnetism (Eds.
- J. A. C. Bland and B. Heinrich) (Berlin–Heidelberg: Springer: 2005).
- 4. В. Ф. Мещеряков, *Письма в ЖЭТФ*, **76**: 836 (2002).
- 5. L. C. C. M. Nagamine, J. Geshev, T. Menegotto, A. A. R. Fernandes, A. Biondo, and E. B. Saitovitch, J. Magn. Magn. Mater., 288: 205 (2005).
- 6. S. Kazan, A. Cemil Başaran, B. Aktaş, M. Özdemir, and Y. Öner, *Phys. B*, 403: 1117 (2008).
- 7. S. Andersson and V. Korenivski, IEEE Trans. Magn., 46: 2140 (2010).
- 8. S. Andersson and V. Korenivski, J. Appl. Phys., 107: 09D711 (2010).
- 9. A. M. Kadigrobov, S. Andersson, D. Radić, R. I. Shekhter, M. Jonson, and V. Korenivski, *J. Appl. Phys.*, **107**: 123706 (2010).
- A. F. Kravets, A. N. Timoshevskii, B. Z. Yanchitsky, O. Yu. Salyuk, S. O. Yablonovskii, S. Andersson, and V. Korenivski, J. Magn. Magn. Mater., 324: 2131 (2012).
- А. Ф. Кравец, А. И. Товстолыткин, И. М. Козак, Ю. О. Тихоненко, Ю. А. Савина, В. А. Пащенко, *Металлофиз. новейшие технол.*, 35, № 12: 1675 (2013).
- 12. A. F. Kravets, A. N. Timoshevskii, B. Z. Yanchitsky, M. A. Bergmann, J. Buhler, S. Andersson, and V. Korenivski, *Phys. Rev. B*, 86: 214413 (2012).
- 13. A. M. Kadigrobov, S. Andersson, D. Radić, R. I. Shekhter, M. Jonson, and V. Korenivski, *J. Appl. Phys.*, **107**: 123706 (2010).
- 14. A. M. Kadigrobov, S. Andersson, Hee Chul Park, D. Radić, R. I. Shekhter, M. Jonson, and V. Korenivski, *J. Appl. Phys.*, **111**: 044315 (2012).
- 15. D. Mauri, H. C. Siegmann, P. S. Bagus, and E. Kay, *J. Appl. Phys.*, **62**: 3047 (1987).
- R. Topkaya, M. Erkovan, A. Öztürk, O. Öztürk, B. Aktaş et al., *J. Appl. Phys.*, 108: 023910 (2010).
- 17. M. Farle, Rep. Prog. Phys., 61, No. 7: 755 (1998).
- А. Б. Дровосеков, Н. М. Крейнес, Д. И. Холин, В. Ф. Мещеряков, М. А. Миляев, Л. И. Ромашев, В. В. Устинов, *Письма в ЖЭТФ*, 67: 690 (1998).
- 19. А. И. Спольник, А. С. Абызов, И. В. Волчок, М. А. Чегорян, Доповіді НАН України, 11: 78 (2009).
- 20. H. R. Zhai, X. B. Zhu, M. Lu, Q. S. Bie, Y. B. Xu, Y. Zhai, Q. Y. Jin, M. Jimbo, and S. Tsunashimad, *J. Magn. Magn. Mater.*, **140–144**: 525 (1995).

- 21. Z. Zhang, L. Zhou, P. E. Wigen, and K. Ounadjela, *Phys. Rev. Lett.*, **73**: 336 (1994).
- 22. J. Dubowik, F. Stobiecki, and T. Lucin'ski, Phys. Rev. B, 57: 5955 (1998).
- Д. М. Полищук, А. И. Товстолыткин, S. К. Arora, B. J. O'Dowd, and I. V. Shvets, Физика низких температур, 40, № 2: 211 (2014).
- 24. A. G. Gurevich and G. A. Melkov, *Magnetization Oscillations and Waves* (Boca Raton, FL: CRC Press: 1996).
- 25. A. I. Tovstolytkin, V. V. Dzyublyuk, and D. I. Podyalovskii, *Phys. Rev. B*, 83: 184404 (2011).
- 26. Y. Lamy and B. Viala, J. Appl. Phys., 97: 10F910 (2005).
- 27. R. H. Nelson, J. Appl. Phys., 35: 808 (1964).
- 28. M. Erkovan, S. T. Öztürk, R. Topkaya, M. Özdemir, B. Aktaş et al., *J. Appl. Phys.*, **110**: 023908 (2011).
- 29. J. Lindner, E. Kosubek, P. Poulopoulos, K. Baberschke, and B. Heinrich, J. Magn. Magn. Mater., 240: 220 (2002).
- 30. J. Dubowik and F. Stobiecki, J. Magn. Magn. Mater., 242-245: 538 (2002).
- 31. J. Lindner and K. Baberschke, J. Phys.: Condens. Matter, 15: R193 (2003).
- Е. Ю. Семук, В. Н. Бержанский, А. Р. Прокопов, В. О. Голуб, Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Физика», 21: 166 (2008).
- 33. A. F. Kravets et al., J. Magn. Magn. Mater., 324: 2131 (2012).
- D. J. Chakrabarti, D. E. Laughlin, S. W. Chen, and Y. A. Chang, *Phase Diagrams of Binary Copper Alloys* (Eds. P. Subramanian, D. Chakrabarti, and D. Laughlin) (Materials Park, OH: ASM International: 1994).
- Е. С. Демидов, А. А. Ежевский, В. В. Карзанов, Магнитные резонансы в твёрдых телах (Нижний Новгород: Изд-во ННГУ: 2007).

REFERENCES

- 1. A. F. Kravets et al., *Phys. Rev. B*, 86: 214413 (2012).
- 2. A. F. Kravets et al., Phys. Rev. B, 90: 104427 (2014).
- 3. Ultrathin Magnetic Structures III. Fundamentals of Nanomagnetism (Eds.
- J. A. C. Bland and B. Heinrich) (Berlin-Heidelberg: Springer: 2005).
 V. F. Meshcheryakov, *JETP Letters*, 76: 836 (2002) (in Russian).
- 5. L. C. C. M. Nagamine, J. Geshev, T. Menegotto, A. A. R. Fernandes, A. Biondo, and E. B. Saitovitch, J. Magn. Magn. Mater., 288: 205 (2005).
- S. Kazan, A. Cemil Başaran, B. Aktaş, M. Özdemir, and Y. Öner, *Phys. B*, 403: 1117 (2008).
- 7. S. Andersson and V. Korenivski, IEEE Trans. Magn., 46: 2140 (2010).
- 8. S. Andersson and V. Korenivski, J. Appl. Phys., 107: 09D711 (2010).
- 9. A. M. Kadigrobov, S. Andersson, D. Radić, R. I. Shekhter, M. Jonson, and V. Korenivski, *J. Appl. Phys.*, **107**: 123706 (2010).
- A. F. Kravets, A. N. Timoshevskii, B. Z. Yanchitsky, O. Yu. Salyuk, S. O. Yablonovskii, S. Andersson, and V. Korenivski, J. Magn. Magn. Mater., 324: 2131 (2012).
- A. F. Kravets, A. I. Tovstolytkin, I. M. Kozak, Yu. O. Tykhonenko, Yu. O. Savina, and V. A. Pashchenko, *Metallofizika i Noveishie Tekhnologii*, 35, No. 12: 1675 (2013) (in Russian).
- 12. A. F. Kravets, A. N. Timoshevskii, B. Z. Yanchitsky, M. A. Bergmann,
- J. Buhler, S. Andersson, and V. Korenivski, *Phys. Rev. B*, **86**: 214413 (2012). 13. A. M. Kadigrobov, S. Andersson, D. Radić, R. I. Shekhter, M. Jonson, and
- V. Korenivski, J. Appl. Phys., 107: 123706 (2010).
- 14. A. M. Kadigrobov, S. Andersson, Hee Chul Park, D. Radić, R. I. Shekhter,

158

M. Jonson, and V. Korenivski, J. Appl. Phys., 111: 044315 (2012).

- 15. D. Mauri, H. C. Siegmann, P. S. Bagus, and E. Kay, *J. Appl. Phys.*, **62**: 3047 (1987).
- R. Topkaya, M. Erkovan, A. Öztürk, O. Öztürk, B. Aktaş et al., *J. Appl. Phys.*, 108: 023910 (2010).
- 17. M. Farle, Rep. Prog. Phys., 61, No. 7: 755 (1998).
- 18. A.B. Drovosekov et al., *ZhETF Pis'ma*, **67**: 690 (1998) (in Russian).
- 19. A. I. Spolnik et al., Dopovidi NAN Ukrainy, 11: 78 (2009) (in Russian).
- H. R. Zhai, X. B. Zhu, M. Lu, Q. S. Bie, Y. B. Xu, Y. Zhai, Q. Y. Jin, M. Jimbo, and S. Tsunashimad, J. Magn. Magn. Mater., 140–144: 525 (1995).
- 21. Z. Zhang, L. Zhou, P. E. Wigen, and K. Ounadjela, *Phys. Rev. Lett.*, **73**: 336 (1994).
- 22. J. Dubowik, F. Stobiecki, and T. Lucin'ski, Phys. Rev. B, 57: 5955 (1998).
- 23. D. M. Polishchuk et al., *Fizika Nizkikh Temperatur*, **40**, No. 2: 211 (2014) (in Russian).
- 24. A. G. Gurevich and G. A. Melkov, *Magnetization Oscillations and Waves* (Boca Raton, FL: CRC Press: 1996).
- 25. A. I. Tovstolytkin, V. V. Dzyublyuk, and D. I. Podyalovskii, *Phys. Rev. B*, **83**: 184404 (2011).
- 26. Y. Lamy and B. Viala, J. Appl. Phys., 97: 10F910 (2005).
- 27. R. H. Nelson, J. Appl. Phys., 35: 808 (1964).
- M. Erkovan, S. T. Öztürk, R. Topkaya, M. Özdemir, B. Aktaş et al., J. Appl. Phys., 110: 023908 (2011).
- 29. J. Lindner, E. Kosubek, P. Poulopoulos, K. Baberschke, and B. Heinrich, J. Magn. Magn. Mater., 240: 220 (2002).
- 30. J. Dubowik and F. Stobiecki, J. Magn. Magn. Mater., 242-245: 538 (2002).
- 31. J. Lindner and K. Baberschke, J. Phys.: Condens. Matter, 15: R193 (2003).
- 32. E. Yu. Semuk et al., Uchyonyye Zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta im. Vernadskogo. Ser. Fizika, 21: 166 (2008) (in Russian).
- 33. A. F. Kravets et al., J. Magn. Magn. Mater., 324: 2131 (2012).
- D. J. Chakrabarti, D. E. Laughlin, S. W. Chen, and Y. A. Chang, *Phase Diagrams of Binary Copper Alloys* (Eds. P. Subramanian, D. Chakrabarti, and D. Laughlin) (Materials Park, OH: ASM International: 1994).
- 35. E. S. Demidov, A. A. Ezhevskiy, and V. V. Karzanov, *Magnitnyye Rezonansy v Tvyordykh Telakh* [*Magnetic Resonances in Solids*] (Nizhny Novgorod: NNGU: 2007) (in Russian).